



■ 要素技術開発

材料及びプロセス、デバイス構造の開発

- ・カルドポリマーゲート絶縁膜の開発
(新日鉄住金化学株式会社との共同開発)
- ・新規感光性塗布型絶縁膜の開発
フォトリソプロセスの削減
- ・バンク構造による有機半導体の T F T 素子間分離
- ・有機半導体の塗布プロセス開発
インクジェット、Solution-Shearing
- ・塗布型有機半導体を用いた高密度 T F T における高移動度化
(東ソー株式会社により提供された材料)
- ・オール塗布化に向けた塗布型電極作製プロセス開発中

有機 TFT と有機 EL で構成するフレキシブルディスプレイ

■ ディスプレイの特徴

- ・ 50ppi、画素数：128×100
- ・ 塗布材料を用いた有機 T F T による有機 E L ディスプレイの駆動
- ・ 画素回路：2TFT-1Capacitor
- ・ ボトムエミッション型有機 E L
- ・ 白色マルチフォトンエミッション構造有機 E L
- ・ C F を用いたカラーディスプレイ開発中



3.2インチフレキシブルディスプレイ

